科学研究費助成事業

平成 30 年

研究成果報告書



研究者番号:70311355

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 33,200,000 円

研究成果の概要(和文):本研究では、放射光ナノ集光ビームによるX線磁気円二色性(XMCD)測定技術の開発 を行った。Co/Ni多層膜を試料とした時分割測定により、約100 nmの微小領域に対する磁化ダイナミクスをXMCD 信号変化として検出することに成功した。また、さらに高度なナノ磁化検出技術への挑戦として、軟X線ナノビ ーム走査プローブ顕微鏡(SR-SPM)を開発した。放射光SPMの励起光源として軟X線集光ビーム生成し、SPM探針直 下の試料位置に照射する特徴を有する。従来技術に比べ、SPM探針直下に約1000倍の密度の軟X線ビームを照射 可能である。本装置を用い、パーマロイ磁気ドットのXMCD観察に成功した。

研究成果の概要(英文):We have studied the synchrotron X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) 研究成果の概要(英文): We have studied the synchrotron X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) measurement techniques using the nano-focused X-ray beam and the application to magnetic thins films. The time resolved XMCD signals have been successfully observed for the local area of about 100 nm in a Co/Pt multilayered film, where the applied magnetic fields were generated and synchronized with the pulsed X-rays. As a further advanced technical challenge, we have developed a scanning probe microscope (SPM) measurement technique combined with the synchrotron soft X-rays, which is so called SR-SPM. In the SR-SPM apparatus equipped with an X-ray focusing unit using a Fresnel zone plate, the higher density soft X-ray beam of about 1000 times compared to the previous studies irradiates the sample surface just below the SPM needle. XMCD signals from permalloy dots of the magnetite has been successfully recorded using the SR-SPM system with the special resolution of about 70 nm.

研究分野: 放射光磁気解析

キーワード: X線磁気円二色性 放射光 軟X線 スピントロニクス STM

1.研究開始当初の背景

スピントロニクス先端機能性材料では、材 料を構成する物質の構造・物性をナノスケー ルで制御し、目的の機能を引き出すことを特 徴とする。特に、ナノサイズの磁性体に誘起 される磁化ダイナミクスの制御により、革新 的な機能・性能を実現している点が注目され る。この様子を実験的に観察することが出来 れば、動作中の磁化分布変化に起因する動作 損失や励起モードの状況を特定し、所望の機 能・性能を有するスピンデバイスの開発が加 速されると期待される。

2.研究の目的

本研究は、軟X線ナノビームを用いたX線 磁気円二色性を磁化検出原理として、スピン トロニクス材料の磁化をピンポイント、かつ、 時分割で計測する技術を開発し、各種スピン トロニクス素子磁化挙動を明らかにするこ とを目的とした。

3.研究の方法

本研究では、 軟X線ナノビームによる GHz 帯スピンダイナミクス測定技術の開発、 および、 軟X線ナノビーム走査プローブ顕 微鏡(SR-SPM)の開発にフォーカスした研究 を実施した。

4.研究成果

<u>軟X線ナノビームによる GHz 帯スピンダ</u> イナミクス測定技術の開発

・スピントロニクス素子の励起・反転ダイ ナミクスの理解のためには, GHz 帯の磁化の 歳差運動周期程度の領域での観測が必要で ある。今回実験を行った SPring-8 において は、放射光が幅約 50 ps、繰り返し周波数 200 kHz~20 MHz 程度のパルス状で発生されてい る。このことを利用し、放射光と励起源(磁 場・電圧・電流)のタイミングを同期させる ことで、GHz 帯におけるスピントロニクス素 子のポンプ=プローブ法によるナノ集光時 間分解計測技術の確立を目指した。本課題で は、主に励起源として高周波磁場を用い、ナ ノ磁性体の大振幅磁場下での歳差運動の可 視化に取り組んだ。軟 X 線を用いた XMCD 計 測は SPring-8の BL25SU にて行った。微細加 工により作製した試料を、高周波線路を形成 したプリント基板にマウントし、AI ワイヤで 接続した。プリント基板は SMA コネクタおよ び長さ1mの非磁性高周波ケーブルにより真 空チャンバー外に接続した。試料には、幅 5 µm、厚さ 100nm の Au 高周波線路上に作製し た直径5µmのCo/Pt 多層膜ドットを用いた。 Co/Pt 多層膜の下地膜の一部を電極状に残し、 全電子収量法の検出電極として利用した。図 1にSEM像を示す。ドット位置では、高周波 電流により膜面内方向の高周波磁場が発生 する。試料を AI ワイヤで接続し、プリント 基板の SMA コネクタ間の透過特性を計測した ところ、4 GHz 以下の周波数領域での損失は

2 dB 以下に抑えられていた。SPring-8 で発 生する放射光バンチの幅は約50 ps と見積も られており、時間分解測定のために十分な高 周波特性が実現できることが分かった。また、 真空チャンバー内に設置し磁場を印加して も高周波特性に大きな変化は見られない。



図1 Co/Pt 多層膜ドットの SEM 像

・ナノ磁性体を対象とした XMCD 計測におい ては、SiN メンブレン上に形成した試料で透 過法による計測が行われることが多かった。 しかしながら、この手法ではメンブレンを用 いることで試料作製プロセス大きな制限が 生まれる。そこで本研究では、MCDの検出に、 試料作製プロセスにこれらの制限がない全 電子収量法およびコンバージョン型の全電 子収量法を採用し、MCD 検出を行った。MCD 像の計測は、フレネルゾーンプレート(FZP) により直径約 100 nm に集光した X 線を試料 表面を走査して行った。また、コンバージョ ン型の全電子収量法は、回折次数制限絞り (OSA)に流れる電流を検出して測定した。 周波数3 GHz の高周波電流を試料に印加した 状態で Co L₃端の吸収像および MCD 像を計測 した。図 2 に全電子収量法で計測した像を、 図3にコンバージョン型の全電子収量法で計 測した像をそれぞれ示す。



図2 全電子収量法により計測した Co L₃吸収端の (a)吸収像と(b)MCD 像。



図 3 コンバージョン型の全電子収量法により計 測した Co L₃吸収端の(a)吸収像と(b)MCD 像。

図3の測定では、試料をX線の入射方向に対

して約45°傾けているため、ドットが縦方向 に伸びた長円となって見えている。図2、図 3いずれでも、Coの存在するドット部のみに 明瞭な MCD 信号が検出されている。また、こ の二つの測定でのコントラストの反転は測 定される電流の向きの反転に対応している。 図4に、

高周波磁場の

有無による MCD 信号の 直流磁場依存性を示す。直流磁場は膜面に垂 直方向に印加し、測定は全電子収量法で行っ た。外部磁場が2 k0e 近傍に、高周波磁場に より励起された強磁性共鳴に対応するディ ップがみられている。この結果は、異常 Hall 効果による電気的測定の結果ともよく一致 し、全電子収量法での高周波磁場により励起 された磁性体の MCD 測定が可能であることを 示している。コンバージョン型の全電子収量 法においては、数mA の定常電流を印加した デバイスでも MCD 信号が検出できることが確 認できており、電流印加型のスピントロニク スデバイスへも応用が可能であることを示 した。



図 4 高周波磁場の有無による MCD 信号の直流磁 場依存性の変化。

・ポンプ=プローブ法による時間分解測定の 実現のためには、外部励起源(ポンプ)とプ ローブ光の同期が不可欠である。そこで、放 射光リングからの基準クロック(約508 MHz) を分周して高周波信号発生器の基準信号(約 42 MHz)を生成し、放射光リングの時間的な 揺らぎも含めて高周波機器と同期した。これ らの計測は調整事項が多岐にわたるため、超 高真空が不要な硬X線を用いて試行した。実 験は SPring-8 の BL39XU のナノ集光設備を用 いて行った。試料は前項と同一基板上に作製 した Co/Pt 多層膜ドットを用いた。試料を X 線の入射方向から 60°傾けたため、磁化の面 内成分も MCD 信号として検出される。X 線は KB ミラーを用いて約 100 × 200nm² に集光して ドット中央に照射し、蛍光法により信号を検 出した。図5に、周波数2.5 GHzの高周波磁 場を印加して測定した Pt L3 吸収端の MCD 信 号の時間依存性を示す。印加した周波数と一 致した明瞭な振動が観測されている。この信 号の振動は磁化の歳差運動に対応している。 これまでに3 GHz までの明瞭な MCD 信号の振 動が測定できており、X 線のバンチ幅の 50 ps と同程度の時間分解能での計測が可能であ ることを示した



図5 周波数 2.5 GHz の高周波磁場を印加して測 定した Pt L₃吸収端の MCD 信号の時間依存性。

軟X線ナノビーム走査プローブ顕微鏡 (SR-SPM)の開発

本研究では、ナノ XMCD 装置の空間分解能を 向上させることを目的に「ナノ XMCD/走査プ ロープ顕微鏡複合装置の開発」を実施した。 本装置は、軟 X線ナノビームを生成するため 装置ならびに、軟 X線ナノビームを照射可能 な「光てこ方式非接触原子間力顕微鏡」から 構成される。

・図6に本研究で開発した軟X線ナノビーム を照射可能な走査プローブ顕微鏡の概要図 を示す。本装置は、試料表面から5°もしく は30°の角度で軟X線ナノビームが照射可 能となっている。また、走査プローブ顕微鏡 における探針振動の検出には、真空チャンバ ー外部にレーザー光源をもつ光てこ方式を 採用しており、カンチレバー背面に照射され たレーザー光の光路の変化を四分割フォト ダイオードを通して検出する。真空チャンバ ー外に光源を設置することにより、真空チャ ンバーのベーキングに伴うレーザー光源の 劣化を防いでいる。



図6 本研究で開発した走査プローブ顕微鏡のブロ ックダイアグラム。

図7に走査プローブ顕微鏡ユニットの概要図 を示す。本ユニットは、上部デッキ、下部デ ッキの二段のデッキから構成されている。上 部デッキには、走査プローブ顕微鏡用の装置 が配置されている。走査プローブ顕微鏡の探 針が放射光の光軸付近に来るよう設計され ている。走査プローブ顕微鏡における走査は、 チューブスキャナを用い試料を走査するこ とで実現している。また、探針~試料間距離 の制御にもチューブスキャナを用いている。 下部デッキには、軟X線ナノビーム用の装置 が配置されている。軟X線ナノビームは、フ レネルゾーンプレート(FZP)ならびに回折次 数制限絞り(OSA)を用いて生成する。これら は、FZP 用、OSA 用のそれぞれのホルダが取 り付けられた x-y-z 三軸ステージを用いるこ とで位置を調整することが可能となってい る。上部デッキには、FZP と OSA 用の Via ホ ールが開けられており、この Via ホールを通 して FZP、OSA を放射光の光軸上に移動させ ることが可能となっている。



図7 走査プローブ顕微鏡ユニットの概要図

・システムは、Windows PC、 LabVIEW PXI、 PXI-7852R により構成されており、このシス テムがHF2LI ロックインアンプならびに I/V 変換器からの信号を受け、ピエゾドライバを 制御する。探針・試料間の位置制御など時間 的確定性ならびに高速応答が必要な制御は FPGA が担う。また、全システムはテキストコ マンドで制御可能なインターフェースを有 しており、Python 等のインタープリタ言語を 用いた全自動計測が可能となっている。



図8 軟X線ナノビーム用走査プローブ顕微鏡探針 作製プロセスの概要図。(a)に断面図を、(b) に鳥瞰図を示す。

・軟 X 線を照射した際の試料または探針に流 れる電流を検出するため、軟 X 線ナノビーム 用走査プローブ顕微鏡用探針作製プロセス を開発した。このとき探針先端付近の情報を 優先的に取得するため、探針は先端のみに導 電性薄膜が露出していることが好ましい。図 8 に、軟 X 線ナノビーム用走査プローブ顕微 鏡探針作製プロセスの概要図を示す。本研究 では、探針にオリンパス製のカンチレバーを 用いた。このカンチレバーに対して、イオン ビームスパッタリング装置を用い、図 8 (a) 中の で示した向きに電極用のCr (3 nm)/Au (30 nm)/Cr (3 nm)を成膜した。その後、図 8 中の②~④に示した向きにシールド用の SiO₂ (30 nm)を成膜した。このプロセスを用 いることで、探針先端近傍のみに電極を露出 させた。

・軟 X線ナノビームによる試料状態の変化を 走査プローブ顕微鏡の探針を通して取得す るには、軟 X線ナノビームを探針と試料との ギャップに照射する必要がある。そのため、 軟 X線の照射位置の調整を実施した。図9に、 放射光の光源側から撮影した探針と試料の 写真を示す。



図9 光源側からみたカンチレバーと試料。



図 10 真空チャンバー走査により取得した (a)探 針電流ならびに(b)試料電流像。

また、図 10 に真空チャンバーを二次元走査 することにより得られた探針電流像(図 10(a))ならびに試料電流像(図 10(b))を示す。 図 9 と図 10(a)とを比較することにより、探 針電流像を用いることで約 50 µm の精度で 探針を放射光の光軸へアライメントできる。 また、図 10(a)と図 10(b)とを比較すること より、探針に放射光が照射された場合、試料 電流が減少することが分かる。これは、探針 により放射光が遮蔽されたことを示してい る。本手法を用いて探針を放射光の光軸付近 に移動させた後に、FZP を走査することで、 ナノビームを探針先端へとアライメントし た。



図 11 FZP を走査することにより取得した (a)探針 電流ならびに(b)試料電流像。

図 11 に FZP を走査した際の探針電流像(図

11(a)ならびに、試料電流像(図 11(b))を示す。 図 11(a)では、探針先端形状が画像化されて いることがわかる。本手法を用いることで、 数 100 nm の精度で軟 X 線ナノビームを探針 先端へアライメントすることが可能となっ た。



図 12 FZP 走査よる磁性ドットならびに磁気力探 針の可視化。(a)探針電流像、(b)試料電流像。

・続いて、探針電流、試料電流を用いた磁性 ドットの磁化計測を行った。軟 X 線のフォト ンエネルギーは Co の L₃ エッジと一致する様 設定した。図 12(a)に FZP を走査した際の試 料ならびに探針の探針電流像を、図 12(b)に 同時に取得した試料電流像を示す。いずれの 像においても探針ならびに磁性ドットが可 視化できていることが確認された。さらに、 走査プローブ顕微鏡のチューブスキャナを 用いて試料を走査することにより、磁性ドッ トを可視化した。



図 13 探針試料間に働く相互作用を一定とし、取 得した(a, a')表面凹凸像、(b, b')探針電 流像、(c, c')試料電流像。(a-c)と(a'-c') は、各異なるヘリシティの軟X線を用いた。

図 13(a)にその際の表面凹凸像を、図 13(b) に探針電流像を、図 13(c)に試料電流像を示 す。また、図 13(a'-c')には、軟 X 線のへ リシティを変更して取得した同様の像を示 す。図 13(a)では、磁性ドットを可視化でき ていることがわかる。また、図 13(b)と図 13(b')ならびに図 13(c)と図 13(c')とを比 較すると、軟 X 線のヘリシティにこの像は、 試料の磁化状態を反映していると考えられ る。これらの像の差分をとることで XMCD 像 を得た。図 14 に本研究で得られた XMCD 像を 示す。図 14 の結果より、70 nm 程度の空間分 解能で XMCD 信号を可視化できることが明ら かとなった。本研究では、長軸約 200 nm、短 軸約 100 nm のスポットサイズの軟 X 線ナノ ビームを用いた。今回の実験により得られた 像は、軟×線ナノビームのスポットサイズよ り高い解像度で取得されており、走査プロー プ顕微鏡による高空間分解能化が達成され た。



図 14 探針試料間に働く相互作用を一定とし、取 得した XMCD 像。(a)は探針電流を、(b)は試料 電流を用いて取得した。

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計2件)

<u>N. Kikuchi</u>, H. Osawa, M. Suzuki, and O. Kitakami, Time and Spatially Resolved Hard X-Ray MCD Measurement on a Co/Pt Multilayer Dot Excited by Pulsed RF Field, IEEE Transactions on Magnetics, 查読有, 54, 2018、pp.6100106-1~6.

<u>H. Nomura</u>, N. Yoshioka, S. Miura, and R. Nakatani, Controlling operation timing and data flow direction between nanomagnet logic elements with spatially uniform clock fields, Applied Physics Express, 査読有, 10, 2017, 123004-1~4.

[学会発表](計 15件)

<u>中村哲也</u>,放射光軟X線磁気円二色性に よるスピントロニクス材料研究,第 63 回応 用物理学会春季学術講演会(招待講演), 2016.

吉岡直倫,<u>野村光</u>,中谷亮一,磁性量子セ ルラオートマタに基づく双方向シフトレジ スタ,第40回日本磁気学会学術講演会, 2016.

<u>菊池伸明</u>, GHz 帯のマイクロ波磁場印加下 での Co/Pt 多層膜ドットにおけるナノ XMCD, 第3回 実用スピントロニクス新分野創成研 究会, 2016.

<u>野村光</u>,若狭凌生,中谷亮一,<u>菊池伸</u> <u>明</u>, <u>岡本聡</u>,<u>小谷佳範</u>,豊木研太郎,<u>中村</u> <u>哲也</u>,軟 X 線ナノビーム XMCD/走査プロー ブ顕微鏡複合装置の開発,第 30 回日本放射 光学会年会 放射光科学合同シンポジウム, 2017. <u>菊池伸明</u>,H モードを用いた時間分解 XMCD-FMR 計測,第4回 実用スピントロニク 新分野創成研究会,2017.

<u>菊池伸明</u>,時間分解 XMCD による磁化ダイ ナミクス計測,第5回 実用スピントロニク 新分野創成研究会,2017.

<u>菊池伸明</u>,元素・空間・時間分解 MCD 測定 による強磁性共鳴測定,東北大学金属材料 研究所共同利用ワークショップ(招待講演), 2017.

<u>菊池伸明</u>,時間・空間分解 XMCD による強 磁性共鳴測定,日本物理学会秋季大会(招待 講演),2017.

<u>N. Kikuchi</u>, H. Osawa, M. Suzuki, O. Kitakami, Time and spatial resolved XMCD-FMR measurement on a Co/Pt multilayer dot excited by rf magnetic field in GHz regime, The Magnetic recording conference (招待講演)(国際学会), 2017.

<u>T. Nakamura</u>, XMCD Studies of Magnetic Materials with High Special Resolution and High Magnetic Fields, IUMRS-ICA 2017(招 待講演)(国際学会), 2017.

<u>野村光</u>,吉岡直倫,中谷亮一,磁性シフト レジスタを用いたファンアウト素子,第 41 回日本磁気学会学術講演会,2017.

佐村直樹,若狭凌生,中谷亮一,<u>菊池伸</u> <u>明</u>,<u>岡本聡,小谷佳範</u>,豊木研太郎,<u>中村哲</u> 也,Co/Pt 多層膜に対する軟X線照射下での 走査型プローブ顕微鏡測定,日本金属学会 2017 年秋期(第 161 回)講演大会,2017.

<u>N. Kikuchi</u>, Y. Yomogita, D. Kanahara, <u>S.</u> <u>Okamoto</u>, O. Kitakami, T. Shimatsu, H. Osawa, <u>Y. Kotani</u>, K. Toyoki, M. Suzuki, <u>T.</u> <u>Nakamura</u>, Elementally resolved ferromagnetic resonance by X-ray magnetic circular dichroism on Co/Pt multilayer dots, Magnetics and Optics Research International Symposium(国際学会), 2018.

<u>菊池伸明</u>, XMCD でみるスピンの界面現象, 第6回 実用スピントロニク新分野創成研究 会, 2018.

N. Samura, <u>H. Nomura</u>, R. Nakatani, <u>N. Kikuchi, S. Okamoto, Y. Kotani</u>, K. Toyoki, <u>T. Nakamura</u>, Electrostatic force measurement on magnetic thin film under soft X-ray irradiation, Magnetics and Optics Research International Symposium (国際学会), 2018.

[図書](計 0件)
[産業財産権]
出願状況(計0件)
取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等 なし

6.研究組織
 (1)研究代表者
 中村 哲也(Nakamura, Tetsuya)
 高輝度光科学研究センター・利用研究促進
 部門・主席研究員
 研究者番号:70311355

(2)研究分担者
 小谷 佳範(Kotani, Yoshinori)
 高輝度光科学研究センター・利用研究促進
 部門・研究員
 研究者番号:10596464

野村 光(Nomura, Hikaru) 大阪大学・工学研究科・助教 研究者番号:20506258

菊池 伸明(Kikuchi, Nobuaki)
 東北大学・多元物質科学研究所・助教
 研究者番号:80436170

岡本 聡 (0kamoto, Satoshi) 東北大学・多元物質科学研究所・准教授 研究者番号:10292278

(3)研究協力者 なし